

公開番号 又は 特許番号	WO2011-096353、再表 2011-096353
発明名称	微細構造の形成方法および微細構造を有する基体
出願人 又は 権利者	株式会社フジクラ、国立大学法人東京大学
想定デバイス	その他
要約	<p>【利用分野】 レーザー及びエッチングによる微細構造の形成方法および微細構造を有する基体に関するもの。</p> <p>【発明の内容】 この微細構造の形成方法は、加工適正値を有する基板を準備し、前記基板の内部に対して、前記基板の前記加工適正値に近い照射強度で、ピコ秒オーダー以下のパルス時間幅を有するレーザー光を、前記レーザー光の伝搬方向と、前記レーザー光の偏波方向（電場方向）に対して垂直な方向とからなる平面内に照射し、前記レーザー光を集光した焦点、および該焦点に近い領域に構造改質部を形成し、前記構造改質部に対して選択的にエッチング処理を行い、微細孔からなる微細構造を形成する。</p> <p>※2010年2月5日に、日本に出願された特願 2010-024775 号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。</p>
図面	